

再曝気係数に及ぼす界面活性の影響について(Ⅲ)  
(表面近傍の乱れの様子について)

九州大農工部 正員 藤谷陽一

学生員 多田基公

学生員 森山聰二

1. まえがき 再曝気機構の解明を目的として、筆者 KANOMAX 1287W を用いて水深 4, 2, 1, 0.5, 0.3 cm については再曝気速度に対する界面活性剤の影響を解明して測定した。今回は蒸留水と Tween 80,  $1.0 \times 10^{-2}$  ppm にいた。液膜係数は表面の伸縮運動によって律連される。この結果を示す。乱れの水平方向鉛直方向のエネルギースペクトルを重ねたものを図 2~11 に示す。今回の測定では慣性領域及び粘性領域を明瞭に得ることが出来た。これは搅拌装置が不備であった為と思われる。

2. 実験方法及び実験結果 実験には図-1 の様な円形木槽を回転円板上に固定し、木槽を回転させて平均流速を与えた。乱れは木槽と等速で回転する搅拌板を上下動させて起した。板の直径は 56 cm で、板には直径 3 cm の穴を約 100 個あけた。板の振幅は 1 cm、振動数 60 rpm、木槽の回転速度 10 rpm で水深 25 cm から搅拌板上面まで水深 10 cm である。乱れはホットフィルム

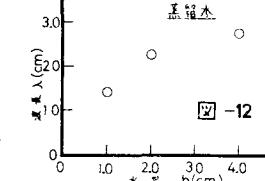
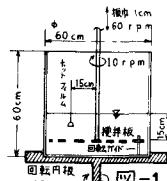


図-12

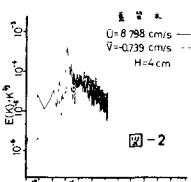


図-2

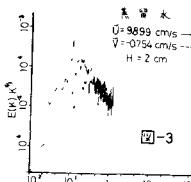


図-3

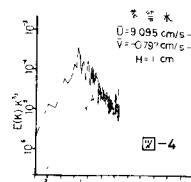


図-4

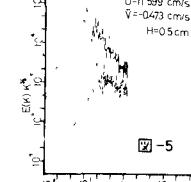


図-5

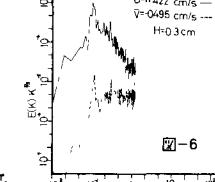


図-6

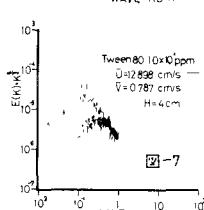


図-7

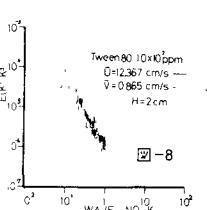


図-8

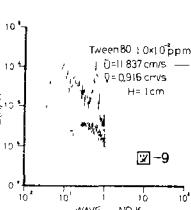


図-9

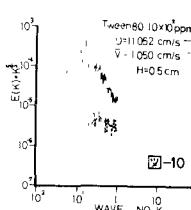


図-10

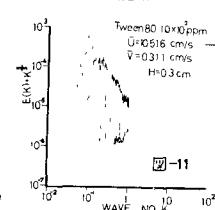


図-11

すなわち、蒸留水では深さ1cmまで異方性の乱れと等方性の乱れの波数が区別できるのに対して、Tween 80を含む場合については1cm付近で完全に異方性の乱れとなっている。このことは、界面活性剤は表面乱れ運動のうち伸縮を伴う運動を束縛し、従って界面近くの鉛直運動を妨げるが、洞の様な伸縮を伴わない水平運動には関係しないためと考えられよう。

### 3. 表面近くの乱れの構造の解析

界面活性剤の $K_L$ に及ぼす影響を解明する為に、筆者らはLamontのmodelを用いた<sup>3)</sup>。このmodelでは表面での洞のmicro scaleは下から供給される洞の拡散によって決まると考えている。実際の現象を考える場合、表面近傍での平面的洞のcascade downが存在すると考えられる。そこで、本報告ではこの様な表面近傍の洞の性質を主める為、次の様なmodelを考えた。表面まで上ってきる洞は水面での境界条件によって鉛直方向の運動が束縛され扁平な洞にならざるを得ない。そこで、洞の水平方向スケールを代表長さとし、その波数を $K$ とすると代表長さは $1/K$ に比例する。Aを定数として、水面より深さ $y$ 方向に本深さ $z$ をとり、 $y > A/K$ では等方性乱れ、 $y < A/K$ では縦方向スケールの圧縮された異方性乱れの領域とする。この縦方向スケールは $y$ に比例するとする。今、異方性乱れの場合について二次元洞のpower spectrumを $E(k_x, k_y)$ エネルギー遮蔽率を $\epsilon$ とすると慣性領域では、 $E(k_x, k_y) \propto k_x^{2/3} k_y^{4/3}$ である。 $K$ 成分の水平方向代表乱れ強さ $V_R(k)$ は $V_R(k) \propto \epsilon^{1/3} k^{-1/3}$ 、洞の鉛直速度成分は縦方向スケールには比例するので、鉛直方向代表乱れ強さ $V_L(k)$ は $V_L(k) \propto \epsilon^{1/3} k^{-1/3} k_y = \epsilon^{1/3} k^{-1/3}$ と考えられる。従って、鉛直方向拡散係数は $D(k) \propto \epsilon^{1/3} k^{-1/3} \propto \epsilon$ となり、 $K$ の大きいものほど拡散係数に対する寄与が大きいことを表している。一方、 $k > A/y$ （等方性乱れ）の領域では $D(k) \propto \epsilon^{1/3} k^{-1/3}$ であるから、 $K$ の小さいもの程、拡散係数への寄与が大きく、結果、 $K = A/y$ で拡散係数が与えられる。すなわち、

$$D_y = \text{const.} \cdot \epsilon^{1/3} c_{y0} \cdot y^{4/3} \quad (1)$$

となる。水平方向乱れスケール $L$ は $y$ によらないとし

$$\epsilon \propto V_R^3/L \quad (2)$$

とすれば、水平方向のエネルギー保有は、

$$\frac{V_R^3}{L} = A \frac{d}{dy} \left( \frac{V_R}{L^{1/3}} \cdot y^{4/3} \cdot \frac{dV_R^2}{dy} \right) \quad (3)$$

ここで  $y/L = \xi^3$ ,  $V_R^3 = \phi/\eta$  とおくと

$$\frac{d^2\phi}{d\xi^2} = \left( \frac{27}{2A} \right) \cdot \phi$$

$$\text{従って } \phi = \phi_1 \sinh \left\{ \sqrt{\frac{27}{2A}} \cdot \xi \right\} + \phi_2 \cosh \left\{ \sqrt{\frac{27}{2A}} \cdot \xi \right\}$$

$\xi = 0$  で  $V_R$  が有限値をとることから  $\phi_2 = 0$

$V_R$  を表面に於ける乱れの代表強さとして、

$$V_R = V_{R0} \left\{ \frac{\sinh \xi^{1/3}}{\xi} \right\} \quad (4) \quad \xi = \sqrt{\frac{27}{2A}} \cdot \sqrt{\frac{y}{L}} = \left( \frac{y}{y_0} \right)^{1/3}$$

例として、今本<sup>1)</sup>の実測から得た式で、平均内径 $H$ 、

$$V_R/U_* = 1.1 \quad (U_*: \text{摩擦速度}) \text{ とすると}$$

$$L = 0.15 \quad (\text{一定}) \quad (H: \text{水深 } y = H - z)$$

$$\frac{V_R}{U_*} = \begin{cases} 0.79 (z/H)^{-1/3} & 0.1 < (z/H) < 0.6 \\ 0.66 (z/H)^{-2/3} & 0.6 < (z/H) < 1.0 \end{cases} \quad (5)$$

ここで  $V_R/U_* = 0.23$ ,  $y_0/H = 0.0067$  とおくと両者の関係は極めて良く一致する。（図-13）

従って開水路二次元流れに於ては

$$V_R = 0.23 U_* \quad (6)$$

となる。

筆者ら<sup>2)</sup>は、開水路二次元流れについては、次式を真いっている。

$$K_L = 0.12 D_z^{1/2} g^{3/4} \nu^{-1/4} H^{1/3} I^{1/3} \quad (7)$$

$$= 0.12 D_z^{1/2} U_*^{3/4} \nu^{1/4} H^{-1/4}$$

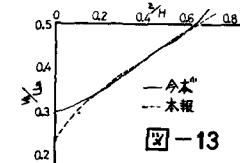


図-13

上式を、表面近傍の乱れを定める  $V_R$  と  $L$  を表わせば、今本に従って、 $L = 0.15 H$  及び、式(6)を用いると

$$K_L = 0.22 D_z^{1/2} V_{R0}^{3/4} \nu^{1/4} L^{-1/4} \quad (8)$$

を得る。

開水路二次元流れでない場合でも、表面近傍の乱れ強度・乱れスケールを測定すれば、これより  $K_L$  を算定し得る。又、界面活性の影響のある場合の  $K_L$  の算定の基礎として式(8)が用いられよう。

尚、乱れのスペクトル計算には九州大学大型計算センターを使用した。

1)今本・浅野・第19回水理講演会論文集、P161

2)栗谷・敷田・昭和48年度土木学会・西部支部論文集

3)栗谷・土谷・第32回土木学会年次学術講演集